

Afisarea articolelor -19-0(1) pentru cuvântul-cheie "Holographic sensitivity"

New photoresists from carbazol-containing photopolymers

Bivol Valeriu¹, Robu Ștefan², Dragalina Galina², Bostan L.², Prisacari A.², Coban A.²

² Moldova State University

Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering

Ediția 4, Vol.4087. 2004. Bellingham, Washington. [ISSN 0277-786X](#).

Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-134



Copyright © 2011-2024 Instrumentul Bibliometric Național.

Institutul de Dezvoltare a Societății Informaționale.

Actualizat: 03.06.2024, accesat: 03.06.2024

Disponibil: <https://ibn.idsi.md>

